

# 上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 400

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 400
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:eH 400 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

美国 KRI [霍尔离子源](#) eH 400上海伯东代理美国原装进口 KRI [霍尔离子源](#) eH 400  
低成本设计提供高离子电流, [霍尔离子源](#) eH 400 尺寸和离子能量特别适合中小型的真空系统,  
可以控制较低的离子能量, 通常应用于离子辅助镀膜, 预清洗和低能量离子蚀刻.尺寸: 直径= 3.7 “ 高=  
3 ” 放电电压 / 电流: 50-300eV / 5a操作气体: Ar, Xe, Kr, O2, N2, 有机前体KRI [霍尔离子源](#) eH  
400 特性 可拆卸阳极组件 - 易于维护; 维护时, \*大限度地减少停机时间;  
即插即用备用阳极 宽波束高放电电流 - 均匀的蚀刻率; 刻蚀效率高; 高离子辅助镀膜 IAD 效率 多用途 -  
适用于 Load lock / 超高真空系统 等离子转换和稳定的功率控制KRI [霍尔离子源](#) eH 400 技术参数:

型号	eH 400 / eH 400 LEHO
供电	DC magnetic confinement
- 电压	40-300 V VDC
- 离子源直径	~ 4 cm
- 阳极结构	模块化
电源控制	eHx-3005A
配置	-
- 阴极中和器	Filament, Sidewinder Filament or Hollow Cathode
- 离子束发散角度	> 45 ° (hwhm)
- 阳极	标准或 Grooved
- 水冷	前板水冷
- 底座	移动或快接法兰
- 高度	3.0'
- 直径	3.7'
- 加工材料	金属电介质半导体
- 工艺气体	Ar, Xe, Kr, O2, N2, Organic Precursors

- 安装距离 6-30 ”
- 自动控制 控制4种气体

\* 可选: 可调角度的支架; SidewinderKRI [霍尔离子源](#) eH 400 应用领域: 离子辅助镀膜 IAD 预清洁 Load lock preclean In-situ preclean Low-energy etching III-V Semiconductors Polymer Substrates 1978 年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司, 研发生产[考夫曼离子源](#), [霍尔离子源](#)和[射频离子源](#). 美国[考夫曼离子源](#)历经 40 年改良及发展已取得多项专利. 离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜 IBSD 领域, 上海伯东是美国[考夫曼离子源](#)中国总代理.

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士